153526 公開実用 昭和59

(9 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報 (U)

昭59—153526

(全

€plnt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和59年(1984)10月15日

G 02 F 1/133

G 09 F 9/00

115 102

7348-2H 7348-2H H 6731-5C

審査請求 未請求

砂液晶表示素子

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

少実

顧 昭58-49034

⑪出 願 人 シャープ株式会社

砂田 願 昭58(1983)3月30日 ⑫考 案 者 岡本誠之

大阪市阿倍野区長池町22番22号 個代 理 人 弁理士 福士愛彦

頁)

- 考案の名称
 液晶表示素子
- 2. 実用新案登録請求の施囲
 - 1. 液晶層の片面若しくは両面に静電気による異常点灯現象を抑制する為の低抵抗物質を被覆したことを特徴とする液晶表示素子。
- 3. 考案の詳細な説明

<技術分野>

本考案は静電気による異常点灯現象を抑制する 為の手段を施した液晶表示素子に関する。

< 従来技術>

従来、液晶表示素子は小型・低消費電力の表示体として多く利用されている。中でもツイストネマチック液晶を用いた電界効果型液晶表示素子(TNFEM液晶表示素子)は時計・電卓等の表示体の主流を占めている。第1図は通常のTNFEM液晶表示素子の概略構成を示す側面断面図である。同図で1.1はガラス等の基板、2.2は該基板1.1上において蒸着.スパッタ等により被複が

公開実用 昭和 59 ─ 153526

なされる I T O 膜(透明電極)、3 . 3 は該 I T O 膜 2 . 2 上に被覆がなされる配向膜、4 はスペーサ、5 は液晶、6 はシール、7 . 7 は上記基板 1 . 1 の外側に設けられる偏光板、8 は反射板である。以上の様な構造の T N F E M 液晶表示素子において、従来偏光板 7 . 7 の表面を指 . 布等でこすると静電気が発生しな発生した静電気によって基板 1 . 1 の内面側に帯電が誘発された。そしてこの帯電した電荷チャージが過度の場合基板 1 . 1 の内面の I T O 膜 2 . 2 における帯電によって液晶分子が励起され誤点灯を生じたのである。

<目 的>

 \bigcirc

本考案は以上の静電気発生に基づく従来問題点を解決するためになされたものであり、上記静電気の発生による過剰の帯電を防止しもって液晶表示素子の誤点灯を未然に防止することを目的とするものである。

<実施例>

以下本考案に係る液晶表示素子の一実施例を図 面を用いて詳細に説明する。



第2図は本考案に係る液晶表示素子の第1の実 施例の概略構成を示す側面断面図である。同図に おいて第1図と同一部分は同一符号で記す。同図 で9.9は低抵抗基板であり、該低抵抗基板9. 9 はガラス、プラスチック等の透明材中に金属粒 子、カーボン粒子(カーボンブラック)等の導電 性粒子を混入してなる基板、あるいは透明プラス チック中にテトラシアノキノジメタン(TCNQ). ポリ窒化サルホン((SN)₂)等の電荷移動錯体 を混入してなる基板である。10、10は上記低 抵抗基板9,9の内面側を絶縁するSiO2等の絶 縁膜である。上記基板9.9は上記混入材の存在 によって抵抗値を低下させたものである。この抵 抗値は混入材の分量によって左右されるが上記基 板 9 . 9 の体 積抵抗値が 1 08 Ω Φ 以下、表面抵 抗値が108 Ω以下であれば過剰の帯電を防止す ることができる。との過剰の帯電が防止可能な理 由としては、基板が低抵抗を有する場合において は偏光板7.7の表面を指.布等でとすり静電気 が発生したよしても基板面上で電荷が分散するの

公開実用 昭和59─ 153526

で部分的に過度の電荷チャージが生じないこと、 及び上記静電気が発生しても基板面から電荷が外 気中に放散される為基板面に電荷が蓄積し難いと とが考えられる。尚、上側の低抵抗基板 9 と下側 の低抵抗基板 9 とを電気的に接続すれば上側の低 抵抗基板 9 と下側の低抵抗基板 9 とが同電位になるので基板内部が略同一電位の物体で覆われることになり上記静電気の防止効果は向上する。 低抵抗基板 9 . 9 の一方若しくは両方を接地すれば、上記静電気の防止効果は更に向上する。

第3図(a)は本考案に係る被晶表示素子の第2の 実施例の概略構成を示す側面断面図である。同図 において第1図と同一部分は同一符号で記す。同 図で11.11は低抵抗膜であり例えばガラス・ プラスチック等の基板1.1上に蒸着・スパッタ リング等によって形成された1TO膜である。こ の低抵抗膜11.11の抵抗値としては面積抵抗 が10° Q/II 以下であれば過剰の帯電を防止す ることができるものである。この過剰の帯電が防 止可機が、理由は第1の実施例と同様であり、又上 側の基板1上の低抵抗膜11と下側の基板1上の 低抵抗膜11とを同電位になす構成、又上側の基 板1上の低抵抗膜11と下側の基板1上の低抵抗 膜11の一方若しくは両方を接地する構成の優位 性も第1の実施例と同様である。第3図(b)は上記 第2の実施例の変形であり、ITO膜等の低抵抗 膜11.11を基板1.1の内面に形成し、更に 上記低抵抗膜11.11をSi02等の絶縁膜12 .12で被覆して絶縁したものである。この構造 では低抵抗膜11.11が密閉されるので該低抵 抗膜11.11からの外気への電荷の放散は多く を期待できないが、上側の基板1内面の低抵抗膜 11と下側の基板 1内面の低抵抗膜 11とを電気 的に接続し同電位になす構成、或いは上側の基板 1内面の低抵抗膜11と下側の基板1内面の低抵 抗膜の一方若しくは両方を接地する構成を採用す れば静電気の液晶層への影響を良好に同避し得る ものである。尚、以下の実施例においてもこの両 者の構成は適用可能である。第3図(c)は上記第2 の実施例の更に他の変形であり、ITO膜等の低

公開実用 昭和59— 153526

抵抗膜11.11.11.11を基板1.1の外面及び内面に形成したものである。

第4図は本考案に係る液晶表示素子の第3の実施例の概略構成を示す側面断面図である。同図において第1図と同一部分は同一符号で記す。同図において13、13は基板1、1及び偏光板7、7の外側に被収されたシリカゲル膜、界面活性剤(アルキルリン酸 エステルナトリウム等)等の吸湿層である。該吸湿層13、13は吸湿作用によってその表面抵抗が10°Q以下になり過剰の帯電が防止することができるものである。この過剰の帯電が防止可能な理由は第1の実施例と同様である。

第 5 図は本考案に係る液晶表示素子の第 4 の実施例の概略構成を示す側面断面図である。同図において第 1 図と同一部分は同一符号で記す。同図において 1 4 . 1 4 は基板 1 . 1 面上に被覆形成された低抵抗ペースト層であり、該低抵抗ペースト層 1 4 . 1 4 はテトラシアノキノジメタン(TCNQ).ポリ窒化サルホン((SN)x)等の

電荷移動錯体を混入してなるペースト層である。 この低低抗ペースト層 1 4 . 1 4 の抵抗値は体積 抵抗が 1 0⁸ Ω · 以下であれば過剰の帯電を防止 することができるものである。この過剰の帯電が 防止可能な理由は第1の実施例と同様である。

第6図は本考案に係る液晶表示素子の第5の実施例の概略構成を示す側面断面図である。同図において第1図と同一部分は同一符号で記す。同図において15はステンレスからなるメッシュ状の金属板であり、16は金属性の反射板である。である。上記メッシュ状の金属板15はメッシュ状の金属板15はメッシュ状の金属板15はメッシュ状の金属板15はメッシュ状の金属板15は水のである。上記メッシュ状の金属板15及び低いの反射板16によって液晶5は極めて低の側である。とができるものである。この過剰である。

第7図は本考案に係る液晶表示素子の第6の実 施例の概略構成を示す側面断面図である。同図に おいて17はアクリル等の透明体に蒸着、スパッタリング等によってITO膜を被覆してなる低低抗板状体である。該低抵抗板状体17を接地すれば静電気を効果的に放散し得る。

第8図は本考案に係る液晶表示素子の第7の実施例の偏光板部分の構成を示す側面断面図である。同図の偏光板以外の構成は第1図と同様である。第8図において、18 18は保護層、19.19は接着剤、20は偏光層、21は液晶セルへの粘着を行なう粘着剤である。上記保護層18.18、接着剤19.19、偏光層20、粘着剤21の少なくとも一層(二層以上でもよい)に金属粘子・カーボン粘子(カーボンブラック)等の導電性粘子、若しくはテトラシアノキノジメタン(TCNQ)ポリ窒化サルホン((SN)x)等の電荷移動錯体を混入し体積抵抗を10⁸Ω ≈ 以下としている。この構造によって過剰の帯電を防止している。この構造によって過剰の帯電を防止している。この調の帯電が防止可能な理由は第1の実施例と同様である。

第9図は木考案に係る液晶表示素子の第8の実

9 4

(8)

施例の偏光板部分の構成を示す側面断面図である。 同図の偏光板以外の構成は第1図と同様である。 第9図において22.22は保護層、23.23 は接着剤、24は偏光層、25は液晶セルへの粘 着を行なう粘着剤である。26は上側の保護層 22の上に被覆されたシリカゲル膜・界面活性剤 (アルキルリン酸エステルナトリウム等)等の吸 湿層である。該吸湿層26は吸湿作用によってそ の表面抵抗が108 Q以下になり過剰の帯電を防 止することができるものである。この過剰の帯電 が防止可能な理由としては第1の実施例と同様で ある。。

第10図は本考案に係る液晶表示素子の第9の実施例の偏光板部分の構成を示す側面断面図である。同図の偏光板以外の構成は第1図と同様である。又第9図と同一部分は同一符号で示す。27は上側の保護層22の上に蒸着・スパッタリング等によって被覆された1T0膜等の低抵抗膜である。この低抵抗膜27の抵抗値としては而循抵抗が10 Ω/ロ 以下であれば過剰の帯電を防止する。

公開実用 昭和59- 153526

ることができるものである。この過剰の帯電が防止可能な理由は第1の実施例と同様である。

第11図は本考案に係る液晶表示素子の第10の実施例の偏光板部分の構成を示す側面断面図である。同図の偏光板以外の構成は第1図と同様である。又第9図と同一部分は同一符号で示す。28は上側の保護層22の上に被覆形成された低抵抗ペースト層であり、該低抵抗ペースト層28はテトラシアノキノジメタン(TCNQ)・ポリ窒化サルホン((SN)x)等の電荷移動錯体を混入してなるペースト層である。この低抵抗ペースト層28の抵抗値は体積抵抗が10°Ω α 以下であれば過剰の帯電を防止することができるものである。この過剰の帯電が防止可能な理由は第1の実施例と同様である。

く効 果>

以上詳細に説明した本考案によれば、液晶層の 片面岩しくは両面に低抵抗物質を被覆したことに よって液晶層に接する電極に静電気を要因とする 過剰の帯電が生ずることがなく、その為異常点灯 現象を防止できるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来の TNFEM 液晶表示素子の概略 構成を示す側面断面図、第2図は本考案に係る液 晶表示素子の第1の実施例の概略構成を示す側面 断面図、第3図(a)は本考案に係る液晶表示素子の 第2の実施例の概略構成を示す側面断面図、同図 (b)はその変形例の概略構成を示す側面断面図、同 図(c)はその他の変形例の概略構成を示す側面断面 図、第4図は本考案に係る液晶表示素子の第3の 実施例の概略構成を示す側面断面図、第5図は本 考案に係る液晶表示素子の第4の実施例の概略構 成を示す側面断面図、第6図は本考案に係る液晶 表示素子の第5の実施例の概略構成を示す側面断 面図、第7図は本考案に係る液晶表示素子の第6 の実施例の概略構成を示す側面断面図、第8図は 本考案に係る液晶表示素子の第7の実施例の偏光 板部分の構成を示す側面断面図、第9図は本考案 に係る液晶表示素子の第8の実施例の偏光板部分 の構成を示す側面断面図、第10図は本考案に係

公開実用 昭和59-153526

る液晶表示素子の第9の実施例の偏光板部分の構成を示す側面断面図、第11図は本考案に係る液晶表示素子の第10の実施例の偏光板部分の構成を示す側面断面図である。

図中、1:基板、 2:1TO膜

3:配向膜、 4:スペーサ、 5:液晶、

6:シール、 7:偏光板、 8:反射板、

9:低抵抗基板、 10:絶緣膜、

11:低抵抗膜、 12:絶縁膜、

13:吸湿層、 14:低低抗ペースト層、

15:金属板、 16:反射板、

17:低低抗板状体、18:保護層、

19:接着剤、 20:偏光層、 21:粘着剤、

22:保護屬、 23:接着剤、 24:偏光屬、

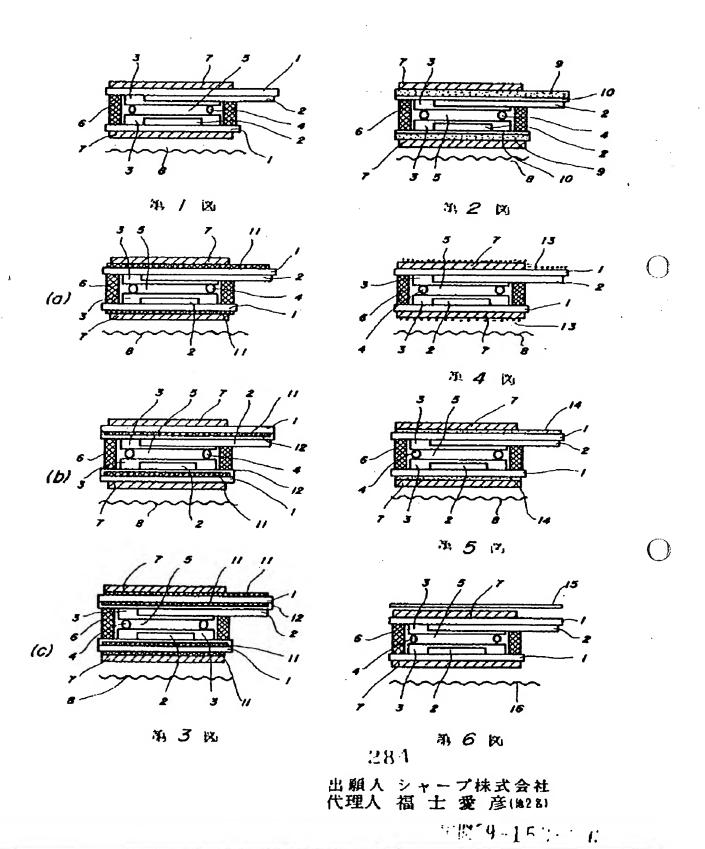
25: 粘着剤、 26: 吸湿層、

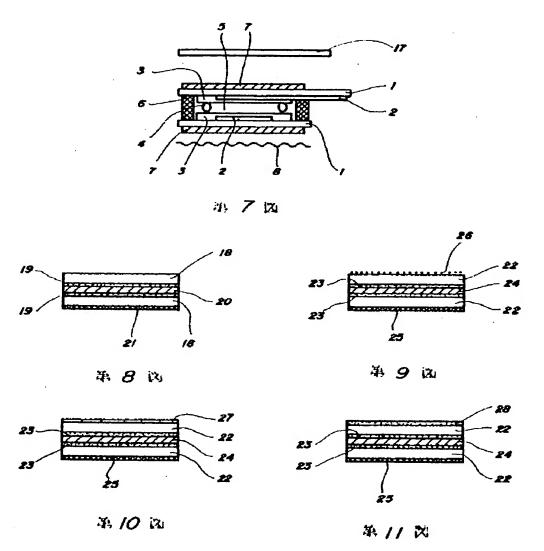
27:低抵抗膜、 28:低抵抗ペースト層。

代理人 弁理士 福 士 愛 彦(他2名)



公開実用 昭和59- 153526





出願人 シャープ株式会社 代理人 福 士 愛 彦(#28)

実閥()。